

<日本特許・実用新案明細書収録セット>

詳しくはホームページにて公開中！<http://www.itdc-patent.com>

\*10年分まとめてCD1枚に収録！

## 無電解（化学）メッキ方法と工程

\*\*\*\*\*

公報種別                      収録年数                      収録点数  
 [ 公告・登録編 ]              平成4年～平成13年(10年間)      856点

全文PDF CD-ROM 版 合計¥269,400              ¥179,970 - (税込価格)

### 収録既刊セット (以下の特許収録セットを全て含んでおります。)

(本体価格)

No, 9428(D)	登録特許	無電解（化学）メッキ方法と工程	平.13	111点	¥25,000
No, " (C)	"	"	平.12	133点	¥25,000
No, " (B)	"	"	平.11	116点	¥25,000
No, " (A)	"	"	平.10	113点	¥25,000
No, 8376(B)	"	"	平.9	59点	¥27,200
No, " (A)	公告・登録	"	平.8	50点	¥22,800
No, 7955	公告特許	"	平.7	64点	¥28,100
No, 7905(B)	"	"	平.6	69点	¥30,800
No, " (A)	"	"	平.5	70点	¥30,800
No, 7522	"	"	平.4	71点	¥29,700

(収録点数・内容は予告なく変更することがございます。予めご了承下さい。)

今までお客様にご愛顧頂いております「特許収録セット」を、約10年分のデータを集結した「特許収録セット10年セット版」をご用意いたしました。過去10年間に発行いたしました各テーマの収録セットの内容を全てCD一枚に収録し、検索機能もできるCD-ROM版と同様に「しおり機能」「ハイパーリンク機能」の2大機能を付加してお届けします。

しかも！過去10年間の特許収録セットをまとめた上に、お値段は全収録セット合計金額の **30～50%OFF!!** という**超お買得商品**としてご提供いたします！

是非！この機会をお見逃しなく。

\*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: kokusai@itdc-patent.com              お電話でも承ります)

[ 10年セット版はPDFファイルに「しおりリンク機能」、目次に「ハイパーリンク機能」を付加しております。 ]

ご注文頂きましたら6～7営業日中に請求書同封の上お送り致します。

### お 申 込 書

会 社 名	ご 注 文 内 容
	ニュースガイド No. X021 CD-ROM版
所 属 部 署	題 名 「無電解（化学）メッキ方法と工程」（10年セット版）」
	合計(税込価格) ¥ 179,970 -
担 当 者 名	E-mail
	(              )              FAX              (              )
住所 〒	

料金には別途送料がかかります。

# 無電解(化学)メッキ方法と工程

No.X021

[公告・登録編]

平成4年～平成13年(10年間)

856点収録

CD-ROM版 ¥179,970 (税込価格)

## 公開実用新案 平成4年

- ・多孔質体の製造方法 三菱マテリアル株式会社
- ・繊維束のメッキ方法 東レ株式会社
- ・無電解めっき用接着剤 日立化成工業株式会社
- ・透明導電路のメタライズ方法 ノキア・ウンターハルトウンスエレクトロニクス株式会社
- ・メッキ液濃度制御装置 キヤノン株式会社

## 日本特許公開 平成5年

- ・金属被膜を有するシラスバルーンの製造方法 アサオカ株式会社
- ・化学めっき用積層板の製造方法 住友ベークライト株式会社
- ・プリント配線版の無電解銅めっき装置 東京化工機株式会社
- ・外装部品の多彩化方法 シチズン時計株式会社
- ・磁気ディスク基板のめっき装置 株式会社中央製作所
- ・非導電性基材上に金属図形を形成する方法 アンブーアクソ コーポレーション
- ・選択的メッキ方法 株式会社井上ジャパックス

## 日本特許公開 平成6年

- ・チップオンボード イビデン株式会社
- ・はんだ付け可能なめっきしたプラスチック部材 ヒューズ・エアクラフト・カンパニー
- ・ABS系樹脂メッキ製品 電気化学工業株式会社
- ・金属被膜無機粉体の製造方法 三菱マテリアル株式会社
- ・微細多孔質ポリテトラフルオロエチレン部材中の有効孔サイズを調整可能に減少する方法 タブコ・エル・ゴレ アンドアソシエイツ、インコーポレイテッド
- ・パナジウム低級酸化物薄膜の製法 新興化学工業株式会社
- ・選択的メッキ法 呉羽化学工業株式会社

## 日本特許公開 平成7年

- ・フッ素系高分子成形品の化学めっき方法 工業技術院長
- ・無電解銅メッキ方法 松下電工株式会社
- ・基盤の無電解メッキ方法 株式会社ブランテックス
- ・機械的性質の優れた銅被膜の形成方法 ブラザー工業株式会社
- ・メッキ前処理方法 住友金属鉱山株式会社
- ・印刷回路板の製造方法 ウェスチングハウス エレクトリック コーポレーション
- ・セラミックス部材の選択めっき方法 株式会社東芝
- ・無電解はんだめっき浴組成物 株式会社コソク

## 日本特許公開 平成8年

- ・無電解めっき浴 早稲田大学
- ・無極性樹脂表面処理剤 栄電子工業(株)
- ・紫外レーザーによる導体パターン形成方法 三菱電機(株)
- ・はんだ膜形成方法 日本電気(株)

## 日本特許公開 平成9年

- ・無電解複合めっき装置 上村工業株式会社
- ・無電解錫めっき浴及び無電解錫めっき方法 上村工業株式会社
- ・めっき浴中の金属イオン濃度の分析方法 上村工業株式会社
- ・パラジウム活性剤及び無電解めっき方法 上村工業株式会社
- ・化学銅めっき液 株式会社デンソー
- ・配線板の製造法 日立エーアイシー株式会社

## 日本特許公開 平成10年

- ・永久磁石 ティーディーケイ株式会社
- ・磁気記録媒体の製造方法 ブラザー工業株式会社
- ・穴空き中空部材の化学処理方法 松田 清造
- ・無電解錫、鉛又はそれらの合金めっき浴の分析方法 上村工業株式会社
- ・磁気光学素子の製造方法 三洋電機株式会社
- ・有機重合体物質のコンディショニング方法 インターナショナル・ビジネス・マシーンス・コーポレーション

## 日本特許公開 平成11年

- ・磁気記録体 上村工業株式会社
- ・繊維束の連続無電解めっき方法 三菱化学株式会社
- ・連続鋼帯等の表面処理プロセスにおける薬液の除去、及び当該薬液回収方法 新日本製鐵株式会社;株式会社増田製作所
- ・ゴム補強用ワイヤおよびその製造方法 東京製鋼株式会社
- ・アルミニウム合金の表面処理方法 株式会社 神戸製鋼所
- ・樹脂メッキ製品 帝人化成株式会社

## 日本特許公開 平成12年

- ・無電解めっき用接着剤調製用の原料組成物および無電解めっき用接着剤の調製方法 イビデン株式会社
- ・耐寒性に優れた内面保護皮膜付き銅又は銅合金管及びその製造方法 株式会社神戸製鋼所
- ・内面被覆銅又は銅合金管及びその製造方法 株式会社神戸製鋼所
- ・タングステン材およびその製造方法 株式会社野毛電気工業
- ・銅被覆炭素粉末 株式会社河口商店;有限会社エムティーケミカル
- ・水素センサ、ガスセンサ用またはpH応答用金属薄膜製造方法 株式会社堀場製作所

## 日本特許公開 平成13年

- ・配線板用接着剤シート イビデン株式会社
- ・表面処理方法及び表面処理装置 上村工業株式会社
- ・2層フレキシブル基板の製造方法 住友金属鉱山株式会社
- ・半導体装置の表面処理方法及び表面処理装置 日本電気株式会社
- ・アディティブ法におけるメッキ液の前処理方法 イビデン株式会社
- ・金のノンシアン浴を用いた複合めっき方法 株式会社山王

各年度より抜粋

